

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第1区分
 【発行日】平成19年11月1日(2007.11.1)

【公開番号】特開2000-251648(P2000-251648A)
 【公開日】平成12年9月14日(2000.9.14)
 【出願番号】特願平11-48496
 【国際特許分類】

H 0 1 J 5/03 (2006.01)

H 0 1 J 29/87 (2006.01)

H 0 1 J 31/12 (2006.01)

【F I】

H 0 1 J 5/03

H 0 1 J 29/87

H 0 1 J 31/12 C

【手続補正書】

【提出日】平成19年9月13日(2007.9.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子放出領域を備えたリアプレートと、
前記リアプレートと対向し、前記電子放出領域から放出された電子が照射される電子照射領域を備えたフェースプレートと、
前記リアプレートと前記フェースプレートとの間に設置された絶縁性の支持体と、
前記電子放出領域と前記電子照射領域とに挟まれる空間の外に備えられ、前記支持体を前記リアプレートもしくは前記フェースプレートに固定する絶縁性の固定部材と、
を有し、
前記支持体の前記空間内の部分と、前記支持体の前記固定部材で固定される領域を除いた前記空間外の部分とに、導電性部材が形成されている、
画像形成装置。

【請求項2】 前記導電性部材は、前記電子放出領域と前記電子照射領域との間の電場の方向と垂直な方向に沿って複数設けられている、請求項1に記載の画像形成装置。

【請求項3】 前記導電性部材は面積抵抗が $10^7 \sim 10^{14}$ / である高抵抗膜である、請求項1または2に記載の画像形成装置。

【請求項4】 前記支持体の前記電子放出領域および前記電子照射領域に当接する面のうちの少なくとも一方の面を含む部分に低抵抗膜が形成され、前記高抵抗膜が前記電子放出領域および前記電子照射領域の少なくとも一方に前記低抵抗膜を介して電氣的に接続されている、請求項3に記載の画像形成装置。

【請求項5】 前記低抵抗膜の少なくとも一部が前記高抵抗膜で覆われている、請求項4に記載の画像形成装置。

【請求項6】 前記低抵抗膜は前記高抵抗膜との境界部が前記高抵抗膜で覆われている、請求項5に記載の画像形成装置。

【請求項7】 前記低抵抗膜の前記電子放出領域または前記電子照射領域と当接する部分を除く部分が前記高抵抗膜で覆われている、請求項6に記載の画像形成装置。

【請求項8】 前記低抵抗膜は全ての部分が前記高抵抗膜で覆われている、請求項7に記載の画像形成装置。

【請求項 9】 前記支持体は前記低抵抗膜が形成された後に前記高抵抗膜が形成されることによって構成されている、請求項 4 から 8 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置。

【請求項 10】 前記支持体の最外表面には前記電子放出領域と前記電子照射領域との間の電場の方向と垂直な方向に沿って複数のストライプ状導電性膜が設けられている、請求項 4 から 9 のいずれか 1 項に記載の画像形成装置。